Влияние сверхстехиометрических компонентов на спектрально-кинетические характеристики люминесценции изовалентно легированных кристаллов ZnSe

© О.В. Вакуленко, В.Н.Кравченко, В.Д. Рыжиков, В.И. Силин, Н.Г. Старжинский

Киевский университет им. Тараса Шевченко, Физический факультет. 252127 Киев, Украина

(Получена 22 апреля 1996 г. Принята к печати 20 марта 1997 г.)

В интервале температур $T = 80 \div 500$ К исследованы спектрально-кинетические характеристики рентгенолюминесценции кристаллов ZnSe, легированных Zn, Se и Te в процессе роста и отожженных (или неотожженных) в парах Zn. Для кристаллов ZnSe, выращенных из шихты стехиометрического состава или с примесью халькогенов, свойственны минимальный уровень послесвечения, а также резкое возрастание интенсивности PЛ и смещение ее максимума из инфракрасной области в красную после их отжига в цинке. Кристаллы ZnSe, выращенные из шихты, содержащей избыток Zn, имеют относительно низкий выход PЛ при значительном уровне послесвечения. Предполагается, что при выращивании кристаллов, активированных Te, в них генерируются термодинамически устойчивые комплексы V_{Zn} Tese, являющиеся центрами излучательной рекомбинации. Введение избытка Zn в исходную шихту приводит к уменьшению концентрации V_{Zn} и, следовательно, центров излучательной рекомбинации.

Показано, что при концентрациях свободных электронов $n < 10^{18} \text{ см}^{-3}$ зависимость времени послесвечения τ от *n* может быть описана в рамках модели излучательной рекомбинации через один примесный уровень, а при $n > 10^{18} \text{ см}^{-3}$ наблюдается уменьшение τ с ростом *n*, которое не может быть объяснено в рамках этой простой модели. Предполагается, что в кристаллах с $n > 10^{18} \text{ см}^{-3}$, полученных в результате длительного отжига в парах Zn, формируются центры излучательной рекомбинации нового типа.

Оптические и электрические свойства кристаллов селенида цинка во многом могут определяться, даже при наличии сторонних примесей, типом и концентрацией собственных точечных дефектов решетки (СТДР) [1,2]. В работах [3–5] теоретически обоснованы и реализованы принципы целенаправленного управления люминесцентными свойствами селенида цинка путем введения изовалентной примеси Те, что позволило получить материал, во многом превосходящий традиционные сцинтилляторы [6]. С учетом обнаруженного определяющего влияния ансамбля СТДР на сцинтилляционные процессы представляет интерес изучение влияния на механизм люминесценции кристаллов ZnSe(Te) избытка собственных компонентов (Zn, Se, Te), вводимых в сырье при синтезе этого материала.

1. Образцы и техника экспериментов

Исследовались кристаллы ZnSe, выращенные методом Бриджмена–Стокбаргера, под давлением ≤ 60 атм. аргона. Во всех опытах использовалась одна и та же партия шихты селенида цинка, прошедшая вакуумную термообработку для уменьшения концентрации сторонних примесей и непрореагировавших компонентов [7]. Избыточные компоненты Zn, Se и легирующая примесь Те вводились в шихту в концентроции 2 вес%. Послеростовая термообработка кристаллов проводилась в парах Zn (24 ч, 1290 K, 1 атм) или в жидком цинке (24–72 ч, 1000 K) [8].

Контроль элементного состава образцов осуществлялся методами рентгенолюминесцентного и химического анализа. Содержание кислородосодержащих примесей составляло ≤ 0.1 вес%, углерода — $5 \cdot 10^{-4}$ вес% и других сторонних примесей не более 10^{-5} вес%. Содержание в кристаллах активатора Те, а также избытка цинка и селена приведено в таблице.

Спектральные характеристики люминесценции кристаллов изучались с помощью измерительновычислительного комплекса КСВУ-23, в качестве источника возбуждения использовался рентгеновский излучатель "РЕИС-И". Кинетика люминесценции исследовалась на специализированном измерительновычислительном комплексе [9]. При измерениях уровня послесвечения η образцы облучались рентгеновским источником "РАПАН-160/200" (W ---анод, 160–200 кВ, 0.1–0.5 мА, $t_{IMP} = 2 c$), а при измерениях времени высвечивания au — рентгеновским источником "Мира-2Д" ($h\nu \leq 200$ кэВ, $t_{IMP} \leq 10$ нс). Уровень послесвечения определялся как отношение интенсивности люминесценции I(t) через $t = 10 \,\mathrm{mc}$ после возбуждения к максимальнаму ее значению За время высвечивания I_M , умноженное на 100%. принималось время, за которое интенсивность люминесценции уменьшалось в е раз после прекращения возбуждения.

2. Экспериментальные результаты

Основные характеристики люминесценции, измеренные при 300 К: положение максимума в спектре свечения λ_M , время высвечивания τ и уровень послесвечения η кристаллов селенида цинка, прошедших резличные виды

Спектрально-кинетические	характеристики	кристаллов	ZnSe			
с изовалентными примесями при 300 К						

N₂	Кристалл	λ_M , нм	au, MKC	η,% через 10 мс	<i>I_{XL}</i> , отн. ед.
<i>A</i> 1	ZnSe	620	< 1	2	1
A2	ZnSe: Zn	628	55	17	12
A3	$ZnSe(Se^0)$	870	< 1	25	1.4
<i>A</i> 4	$ZnSe(Se^0)$: Zn	625	90	< 0.05	150
A5	$ZnSe(Zn^0)$	617	270	20	0.3
<i>A</i> 6	$ZnSe(Zn^0)$: Zn	625	220	23	2
A7	$ZnSe(Te^0)$	830	30	5	0.7
A8	$ZnSe(Te^0)$: Zn	635	80	< 0.05	320
<i>B</i> 1	$ZnSe(Te^{2-})$	890	26	12	83
<i>B</i> 2	$ZnSe(Te^{2-}):Zn$	640	100	< 0.05	980
<i>B</i> 3	$ZnSe(Te^{2-}, Zn^0)$	620	550	7	45
<i>B</i> 4	$ZnSe(Te^{2-}, Zn^0)$: Zn	630	> 5000	31	28
<i>B</i> 5	$ZnSe(Te^{2-}, Se^{0})$	850	70	5	75
<i>B</i> 6	$ZnSe(Te^{2-}, Se^0)$: Zn	640	180	< 0.05	610
B7	$ZnSe(Te^{2-}, Te^{0})$	880	280	21	102
<i>B</i> 8	$ZnSe(Te^{2-}, Te^0)$: Zn	640	140	< 0.05	820
<i>B</i> 9	$ZnSe(Te^{2-}):Zn^*$	595	≤ 3	< 0.05	580

Примечание. *Кристаллы В9 получены путем длительной термообработки кристаллов В1 в цинке.

термообработки, приведены в таблице. В скобках обозначена примесь, вводимая в шихту, через двоеточие — среда отжига образцов. Обозначения Zn^0 , Se^0 , Te^0 соответствуют легированию элементарными компонентами, Te^{2-} — теллуридом цинка.

До отжига в цинке только в трех из восьми выбранных для исследования кристаллах, а именно в образцах A1, A5 и B3, максимум в спектре рентгенолюминесценции (РЛ) расположен в красной области. В остальных пяти образцах — A3, A7, B1, B5, B7 — до отжига доминирует полоса с максимумом в ИК области спектра, а после отжига максимум РЛ перемещается в красную область. При этом значительно возрастает интенсивность РЛ (I_{XL}) и уменьшается уровень послесвечения.

Кристаллы, выращенные из шихты, содержащей избыток Zn, менее чувствительны к отжигу в Zn. Так, в результате процесса $A5 \rightarrow A6$ интенсивность PJI возрастает в 6–7 раз, тогда как процесс $A3 \rightarrow A4$ дает выигрыш в I_{XL} более чем в 100 раз. А в случае перехода $B3 \rightarrow B4$ имеет место обратный результат: уменьшение I_{XL} при значительном возрастании τ и η .

При T = 80 К в спектрах большинства исследованных кристаллов доминирует широкая полоса с максимумом в области $\lambda_M = 620-640$ нм. Исключением являются нелегированные кристаллы типа A1 и производные от них образцы A2 (т.е. отожженные в Zn), в спектрах которых преобладает полоса в $\lambda_M = 560$ нм. К разряду исключительных принадлежит также кристалл B4 с $\lambda_M \approx 500$ нм (рис. 1, a), который к тому же имеет относительно большое время высвечивания.

Для кристаллов *B2* характерна очень высокая температурная стабильность *I*_{XL} и наличие только одной примесной полосы РЛ во всей области T = 4.2-350 K, а также наличие интенсивного прикраевого излучения (см. рис. 1, *a*). Эти результаты согласуются с описанными в [10].

Добавка в шихту ZnSe + ZnTe избытка Zn (кристаллы ВЗ и В4) приводит к значительной термической нестабильности полос РЛ, отсутствию прикраевого излучения и очень затянутой кинетике свечения.

Для кристаллов В9, которые получены путем длительной термообработки образцов типа В1 в цинке при *T* = 1000 K, характерен необычный для кристаллов ZnSe(Te) спектр стационарной РЛ при 300 К — с $\lambda_M = 595 \,$ нм (рис. 1, *b*) и быстрая кинетика затухания при отсутствии послесвечения и прикраевого излучения. С ростом температуры от 80 до 500 К для этих кристаллов обнаружена двойная инверсия доминирующей полосы РЛ: в диапазоне 80-100 К максимум РЛ расположен в области 620-630 нм, в диапазоне 110-350 К при 595 нм, и в диапазоне 400-500 К — снова в области 620–630 нм. Кроме того, при $T < 130 \,\mathrm{K}$ в спектрах РЛ образцов В9 наблюдается инфракрасная (ИК) полоса излучения ($\lambda_M \approx 880$ нм). Вышеотмеченные особенности температурной перестройки спектра РЛ связаны с различными температурными зависимостями интенсивности излучения в максимумах каждой из названных полос (рис. 2). Интенсивность полосы с $\lambda_M = 630$ нм с повышением Т от 80 К уменьшается с энергиями активации термогашения $\varepsilon_T = 0.05, 0.12$ и 0.6–0.7 эВ на температурных участках 80-100, 100-400 и 450-500 К соответственно; интенсивность полосы с $\lambda_M = 595$ нм при повышении Т от 80 до 220 К увеличивается, а при более высоких температурах — уменьшается с $\varepsilon_T = 0.5$ эВ; интенсивность ИК полосы монотонно убывает с ростом температуры и исчезает при $T \approx 120 \,\mathrm{K}$.

3. Обсуждение результатов

По совокупности физико-химических и оптоэлектронных свойств изученные кристаллы селенида цинка можно разделить на две группы: 1) кристаллы, выращенные из шихты стехиометрического состава или с примесью халькогенов, и 2) кристаллы, полученные из шихты, содержащей избыток цинка. Для первой группы до отжига в парах свойственно преобладание в спектрах РЛ ИК полосы, наличие полосы поглощения в области 500-550 нм, а после отжига — резкое возрастание интенсивности РЛ, смещение максимума РЛ в область 630-640 нм и минимальный уровень послесвечения. Формирование центров РЛ в данной группе кристаллов происходит в соответствии с моделью, предложенной в работах [3,4]: при выращивании кристаллов, активированных Те, в них генерируются вакансии цинка V_{Zn}, причем комплексы (V_{Zn}Te_{Se}) являются термодинамически устойчивыми даже при последующем отжиге кристаллов ZnSe(Te) в цинке, а также являются центрами селективного поглощения в области 500-550 нм и излучательной рекомбинации.



Рис. 1. Спектры РЛ кристаллов: *I* — *B*2, *2* — *B*4 при *T* = 80 К (*a*) и кристалла *B*9 при *T*, К: *3* — 80, *4* — 300, *5* — 470 (*b*).

Для второй группы кристаллов свойственны отсутствие селективных полос поглощения в области 470–1500 нм и ИК полос в спектрах РЛ, значительный уровень послесвечения и очень низкий выход РЛ, что можно объяснить следующим. Введение избытка Zn в исходную шихту приводит к тому, что в условиях выращивания в автоклаве, т.е. при температурах, достигающих 1900 К, и избыточных давлениях в десятки атмосфер данная сверхстехиометрическая компонента может входить в решетку кристалла, заполняя вакансии в узлах катионной подрешетки и препятствуя формированию комплексов типа ($V_{Zn}Te_{Se}$), и более того вызывать генерацию вакансий в анионной подрешетке V_{Se} (и межузельных Se₁), образующих в запрещенной зоне глубокие донорные уровни с $E_a = 0.3 - 0.45$ эВ [11].

В такого рода кристаллах, обычно высокоомных, должна иметь место значительная пространственная неоднородность электрических и оптических параметров, вызванная флуктуационным потенциалом примеси [12]. Последний, как известно [13], обусловливает долговременную, так называемую "замороженную" фотопроводимость в полупроводнике. В этом, как нам кажется, причина затянутой кинетики затухания РЛ в образцах *B*3 и *B*4.

В подтверждение вышесказанному в образцах второй группы нами обнаружены нелинейные вольт-амперные характеристики типа варисторных.

Отсутствие прикраевого излучения также можно объяснить влиянием флуктуационного потенциала примеси, который вызывает пространственное разделение зарядов в возбужденных электронно-дырочных парах [14], препятствуя образованию экситонов или прямой зоназонной рекомбинации.

Относительно временных характеристик люминесценции исследованных образцов заметим следующее. Известно, что в кристаллах *n*-типа со средней высокой проводимостью время высвечивания (τ) обусловлено двумя основными факторами: временем захвата дырки на центр рекомбинации (τ_p) и временем рекомбинации электрона (свободного или донорного) со связанной дыркой (τ_n) . В условиях, когда $\tau_p \ll \tau_n$, время высвечивания $\tau \approx \tau_n$. Величина τ_n , очевидно, обратно пропорциональна полной концентрации свободных электронов *n*, которая равна сумме двух концентраций: темновой (n_0) и неравновесной (n_1) . При достаточно больших значениях n_0 можно принять $n \approx n_0$, так что $\tau \sim (n_0)^{-1}$. В соответствии с этим, на рис. З мы имеет прямую в зависимости $\ln(\tau^{-1})$ от $\ln(n_0)$ при $n \leq 10^{15}$ см⁻³.

При $n_0 > 10^{15} \text{ см}^{-3}$ уменьшение τ с ростом n_0 ограничивается, по-видимому, величиной τ_p , которая определяется концентрацией центров захвата-рекомбинации (N). Как видно из рис. 3, в пределах $10^{15} \leq n_0 \leq 10^{18} \text{ см}^{-3}$ время τ остается практически неизменным, что может свидетельствовать о постоянстве N в этих образцах. В



Рис. 2. Температурная зависимость интенсивности полос РЛ кристаллов *B*9 с λ_M , нм: 1 - 595, 2 - 630, 3 - 880.



Рис. 3. Зависимость времени высвечивания τ от концентрации n_0 свободных носителей: I — теория , 2 — эксперимент на кристаллах ZnSe(Te).

независимости N от n_0 нет ничего необычного, поскольку концентрация основных центров рекомбинации задается, как мы уже отмечали, концентрацией V_{Zn} , а последняя определяется условиями роста кристалла, тогда как последующий отжиг образцов в Zn, завершающий формирование центров излучательной рекомбинации, определяет величину n_0 , которая при одних и тех же значениях концентраций вакансий Zn может меняться в широких пределах.

С целью более подробного описания рекомбинации неравновесных носителей зарядов в низкоомных образцах ZnSe *n*-типа (отожженных в цинке) рассмотрим простейшую схему электронных переходов с одним уровнем рекомбинации (E_a). Соответствующие кинетические уравнения будут иметь следующий вид:

$$dp/dt = g - C_p p(N - p_a), \tag{1}$$

$$dp_a/dt = C_p p(N - p_a) - C_n n p_a.$$
 (2)

Здесь g — темп генерации электронно-дырочных пар при межзонном возбуждении, p — концентрация неравновесных свободных дырок в валентной зоне, p_a концентрация локализованных на центрах рекомбинации неравновесных дырок, $C_{p,n}$ — коэффициенты захвата дырок или электронов, соответственно, на примесный центр. Остальные обозначения уже встречались в тексте. Интенсивность люминесценциии $I_{XL} = C_n n p_a$.

В условиях неравенства $p_a \ll N$ решение системы (1)–(2) дает

$$p_a(t) = \frac{p_{\infty}}{\tau_p/\tau_n - 1} e^{-t/\tau_p} + \left[(p_a)_{\infty} - \frac{p_{\infty}}{\tau_p/\tau_n - 1} \right] e^{-t/\tau_n}, \qquad (3)$$

где p_{∞} , $(p_a)_{\infty}$ — стационарные (начальные) концентрации неравновесных свободных и локализованных дырок соответственно; $\tau_n = 1/nC_n$, $\tau_p = 1/C_pN$. Как видно из (3), закон затухания люминесценции в общем случае не является экспоненциальным. Рассмотрим два частных случая. При $\tau_p \gg \tau_n$ доминировать будет первый член в правой части выражения (3), т.е. время затухания люминесценции будет определяться концентрацией центров рекомбинации. Для случая $\tau_p \ll \tau_n$ имеем $p_a(t) \sim \exp(-t/\tau_n)$, т.е. кинетика люминесценции определяется концентрацией свободных электронов.

Итак, предложенная схема электронных переходов позволяет объяснить поведение τ при $n < 10^{18}$ см⁻³. Однако при $n > 10^{18}$ см⁻³ время высвечивания снова уменьшается в ростом n. Это может означать, что в сильно легированных кристаллах или же формируются центры захвата-рекомбинации нового типа, или же каким-то образом видоизменяется форма электронного трека, возбужденного квантом рентгеновского излучения.

Еще одна возможная причина уменьшения времени высвечивания РЛ с ростом темновой концентрации электронов — это влияние безызлучательных переходов типа оже-процессов, когда энергия рекомбинирующего электрона передается другому свободному электрону (третьей частице), который благодаря этому становится "горячим" [13]. Оже-процессы на свободных носителях становятся существенными только при высоких концентрациях последних, что мы и имеем в данном случае. К тому же интенсивность РЛ кристалла *B*9 ниже, чем интенсивность РЛ родственного ему кристалла *B*2, так что роль безызлучательных переходов в случае кристалла *B*9 более существенна. В пользу оже-процессов может свидетельствовать и отсутствие прикраевого излучения в наиболее низкоомных кристаллах.

Что же касается предположения о формировании центров рекомбинации нового типа при больших концентрациях свободных электронов, то оно подтверждается тем, что в наиболее низкоомном кристалле В9 наблюдается аномальный спектр РЛ с $\lambda_M = 595$ нм при T = 300 К с аномальной температурной зависимостью интенсивности свечения. Полоса с $\lambda_M = 595$ нм наблюдалась также в низкоомных кристаллах ZnSe:Zn $(n > 10^{19} \text{см}^{-3})$, полученных после длительного отжига стехиометрических образцов в жидком цинке [15]. Исходя из предпосылок об образовании новых центров можно высказывать некоторые предложения относительно их структуры. Скорее всего новый центр будет иметь такой состав: V_{Zn}^{2-} Te_{Se} $(Zn_I^+)_n$, где $n \ge 2$. Атом Te, замещающий атом Se, играет в данном комплексе роль стабилизатора вакансий V_{Zn}, не давая атомам Zn занять пустые узлы. Итак, мы имеем комплекс V_{Zn}^{2-} Te_{Se}, окруженный двумя или большим числом межузельных атомов цинка. Такой центр будет иметь отталкивающий барьер для дырки и малую вероятность ее захвата при низких температурах. С ростом температуры вероятность захвата дырки резко возрастает и, как результат, увеличивается интенсивность высвечивания в полосе в $\lambda_M = 595$ нм.

Заключение

Кристаллы ZnSe, выращенные из шихты стехиометрического состава или с примесью халькогенов, и кристаллы, выращенные из шихты, содержащей избыток цинка, существенно различаются по своим спектральнокинетическим люминесцентным характеристикам, что указывает на доминирующую роль собственных дефектов решетки в формировании центров излучательной рекомбинации в этом материале.

Значительное изменение параметров рентгенолюминесценции кристаллов после их длительного отжига в цинке связано, по-видимому, с формированием центров рекомбинации нового типа, характеризующихся аномальной температурной зависимостью интенсивности люминесценции.

Экспериментальная зависимость времени высвечивания от концентрации свободных электронов в кристаллах ZnSe *n*-типа может быть интерпретирована в рамках модели рекомбинации через один примесный уровень, а также существенной ролью оже-процессов при высоких концентрациях свободных носителей.

Список литературы

- А.Н. Георгобиани, М.Б. Котляревский. Физика соединений А^{II}В^{VI} (М., Наука, 1986) с. 72.
- [2] В.Д. Рыжиков. Сцинтилляционные кристаллы полупроводниковых соединений А^{II}В^{VI}. Получение, свойства, применение (М., НИИТЭХИМ, 1989).
- [3] В.Д. Рыжиков, Э.Ф. Чайковский. Изв. АН СССР. Сер. физ., 43, 1150 (1979).
- [4] В.Д. Рыжиков. Высокоэффективные полупроводниковые сцинтилляционные детекторы на основе соединений А^{II}В^{VI} (М., НИИТЭХИМ, 1984).
- [5] В.Д. Рыжиков, Н.Г. Старжинский. УФЖ, 33, 818 (1988).
- [6] В.Д. Рыжиков. Разработка автоматических систем контроля радиационной безопасности АЭС на базе детекторов нового поколения "сцинтиллятор-фотодиод" (Харьков, ВНИИМ, 1990) с. 3.
- [7] Э.Я. Мелликов, Я.В. Хийе, П.Л. Кукк, И.В. Карпенко. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 18, 363 (1982).
- [8] В.И. Силин, Н.Г. Старжинский, М.Ш. Файнер. Орг. и неорг. матер., № 26, 7 (1990).
- [9] С.М. Игнатов, В.Д. Рыжиков, В.И. Силин, Н.Г. Старжинский, Ю.А. Яковлев. Орг. и неогр. матер., № 26, 14 (1990).
- [10] H.L. Oczkowski. Phys. St. Sol. (a), 68, 199 (1981).
- [11] S. Kishida, K. Matsuura, H. Nagase, H. Mori, F. Takeda, I. Tsurumi. Phys. St. Sol. (a), 95, 155 (1986).
- [12] Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. Электронные свойства легированных полупроводников (М., Наука, 1979).
- [13] Ж. Панков. Оптические процессы в полупроводниках (М., Мир, 1973).
- [14] V.B. Sandomirskii, A.G. Zhdan, M.A. Messerer, I.B. Gurlyaev, Ya.A. Pyasta, A.S. Darevskii. Sol. St. Electron., 16, 1097 (1973).
- [15] V.D. Ryzhikov, V.I. Silin, N.G. Starzhinsky. Nucl. Tracks Radiat. Meas., 21, 53 (1993).

Редактор В.В. Чалдышев

The influense of super-stoichiometric components on spectral-kinetic characteristics of the luminescence of isovalent impurity doped ZnSe crystals

O.V. Vakulenko, V.N. Kravchenko, V.D. Ryzhykov, V.I. Silin, N.G. Starzhinskii

Taras Shevchenko Kiev University, 252127 Kiev, the Ukraine